

| | |
|--------------------|---|
| 氏名 | 大塚 知津子 |
| よみ | おおつか ちづこ |
| 英字 | Ohtsuka, Chizuko |
| オフィスアワー | 前期は月曜日と火曜日13:00～14:30、後期は月曜日13:00～15:00 email:ootuka-c@mizuho-c.ac.jp |
| プロフィール | 時習館高校卒業、名古屋大学工学部合成化学科卒業 |
| | 名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了、名古屋大学大学院工学研究科博士課程満了 |
| 職位 | 理事長、学長、教授 |
| 最終学歴 | 名古屋大学大学院工学研究科（博士課程）単位取得満期退学、名古屋大学大学院工学研究科研究生 |
| 学位 | 工学博士 |
| 所属学会・役職 | 日本化学会、日本分析化学会、クロマトグラフィー科学会 |
| 専門分野 | 分析化学 |
| 研究テーマ | 機器による金属錯体およびキレート試薬の分析 |
| 主な教育・研究及び社会的活動及び業績 | <p>C. Shibata, M. Yamazaki and T. Takeuchi Quantitative Analysis of polybutadiene by means of Pulse FT Carbon-13 NMR Bull. Chem. Soc. Jpn., 50(1977) 311.</p> <p>C. Ohtsuka, H. Wada and G. Nakagawa Reversed-phase ion-pair partition liquid chromatography of chelates with 2-(3, 5-dibrom-2-pyridylazo)-5-[N-ethyl-N-(3-sulphopropyl)amino]-phenol and analogues Anal. Chim. Acta, 223(1989) 339.</p> <p>C. Ohtsuka, H. wada, K. Matsuzawa and G. Nakagawa Chromatographic behaviour of 2-(2-pyridylazo)-5-[N-(sulphoalkyl)amino]-phenol chelates on hydrophobic stationary phases Anal. Chim. Acta, 252(1991) 181.</p> <p>C. Ohtsuka, H. wada, K. Matsuzawa and G. Nakagawa Characterization of 2-(2-pyridylazo)-5-[N-(sulphoalkyl)amino] -phenol derivatives as the pre-column chelating agent for trace metal determination by ion-pair reversed-phase liquid chromatography with spectrophotometric detection Anal. Chim. Acta, 256(1992) 91.</p> <p>H. Wada, M. matsushita, T. Yasui, A. Ycchi, H. Yamada, G. Nakagawa and C. Ohtsuka, Ion chromatography of alkaline earth and heavy metal ions by on-column derivatization with bisazochromotropic acid J. Chromatogr., 657(1993) 87</p> <p>C. Ohtsuka, H. wada, and G. Nakagawa Retention behaviour of metal chelates in ion-pair reversed phase liquid chromatography as a function of mobile phase composition with methanol/water and acetonitrile/water mobile phases Anal. Chim. Acta, 294 (1994) 69.</p> <p>C. Ohtsuka, Y. Mori. S. Hayashi. T. Tsuda and H. Wada Estimation of hydrophobicity using quasi-molecular volume of quaternary ammonium ions J. Liq. Chromatogr. & Related Tech., 23(5)(2000) 669.</p> |